$$\frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{2 \ln \sqrt{10}}{\sqrt{2}} \cdot \ln \frac{N_A}{N_A^2}$$

$$= 2 \cdot 2 \sqrt{2} \sqrt{9} = \sqrt{10} \cdot \ln \left(\frac{10^{16}}{6 \sqrt{10}} \right)$$

$$= 0,736 \sqrt{10}$$

$$R = \frac{1}{Y} = 6402$$

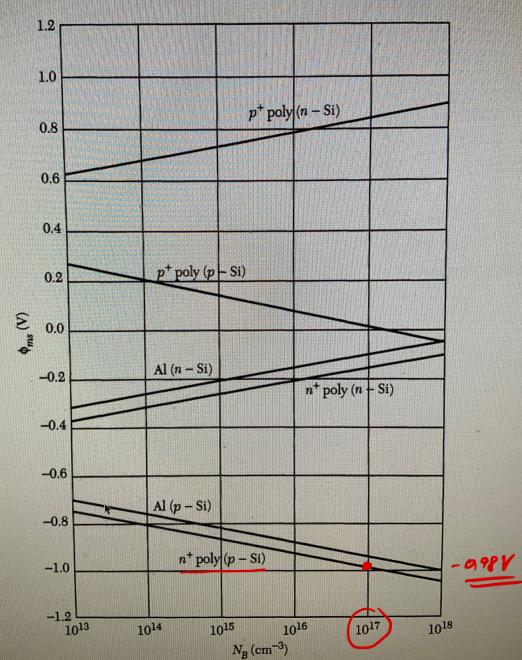
= 6.9. 107 F/cm2 2 dg = \$ 100 - 0,85V $U_{FB} = \phi_{ms} - \frac{(Q_s + Q_m + Q_{ot})}{C_{iso}} \qquad (Q_m - Q_{ot} - O!)$ - - 0,98V - 1.602.10 As.5.10 cui²

6,9.10-7 F/con-2 = - 1,100 Øus - 9m - ds = Different Buischen Whenen and Fermi -Kefall 4L Nivean Wie bound man and que 222 Ces. sei der unclifolge de Graph. Dannit bann der West bestimmt werden. Oder durch tugate in de tuffabe!

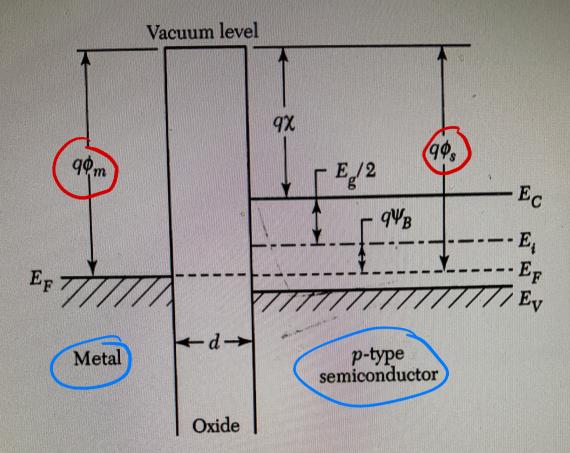
r 6. MOSFET and Related Devices

0 0 T 5

□ 1 /



ig. 8 Work function difference as a function of background impurity concentration for Al, n^+



band diagram of an ideal MOS diode at V = 0.

MOS is defined as follows. (a) At zero applied bias, the enemote work function $q\phi_m$ and the semiconductor work function difference $q\phi_{ms}$ is zero.

$$q\phi_{ms} \equiv \left(q\phi_m - q\phi_s\right) = q\phi_m - \left(q\chi + \frac{E_g}{2} + q\psi_B\right) = 0,$$

m of the three items in the brackets equals to $q\phi_s$. In other wo

$$-0.02U$$
 $0.6V = -0.02V + \frac{e^{T_g}}{C_{iso}}$

Fg = 0,62 U . 6,9. 10-7 +/cm2 · 1 - 2,67 · 10 cm-2

$$C_{iso} = \frac{E_{iso} \cdot E_{o}}{d_{iso}} = \frac{3.9 \cdot 6.1854 \cdot 6^{-14} \cdot \frac{F_{cho}}{f_{cho}}}{5 \cdot 10^{-5} \text{ cm}}$$

(8) Kureleanaleffelde, sis zum Volust der Skuerberheit! Athife: (englische Such Gegriffe) - Threshold voltage roll-off - Drain induced barrier Lavering (DIBL) Hot carrier myechien velocity saturation Quantum confinement A valance breakdown Andere FET - Strubburen, E.B. FIN FET oder soger Paradiguenwecksel, d.h. micht mehr dadeng représubèert logisch 0 oder 1. Beispiel ans der Supraleitung:

Ropid Single Flux Auanteur RSFQ - Logile

magn. Fluß ersetzt Ladeung

to ist die Zeit, in der sich die **(9)** Zuhl n der alchiven Transisforn pro Chip verdoppett. Exponential gesetz: $M = u_0 \cdot 2^{+/4_0}$ (+= +6 =) n - 2mg) Logarithuisen: lu mo = + lu2 gete als mitters Wachstum in Abb. 1 fuhot au to Austrief u im Verlant von 10 Jahren (1975-1985) führt auf eine Erhöhung des Zahl des Transistans pro Chip ont des 30 fache (3.65/104)

$$\lim_{n \to \infty} \frac{m}{n_0} = \frac{1}{10} \lim_{n \to \infty} 2$$

$$\lim_{n \to \infty} 30 = \frac{10a}{10} \cdot \ln 2$$

$$\lim_{n \to \infty} 30 = \frac{10a}{10} \cdot \ln 2$$

=> to = 10à lu 2 = 2,04à

Zeit der Verdopphung des Transisteren pro Chip beträgt etwas mehr als 2 Jahre.

(Hone sagle une Verdopphing alle 18 Monale vorans)